

TECHNOLOGIA USUWANIA POWŁOK PVD KOMPONOWANYCH NA BAZIE CrN

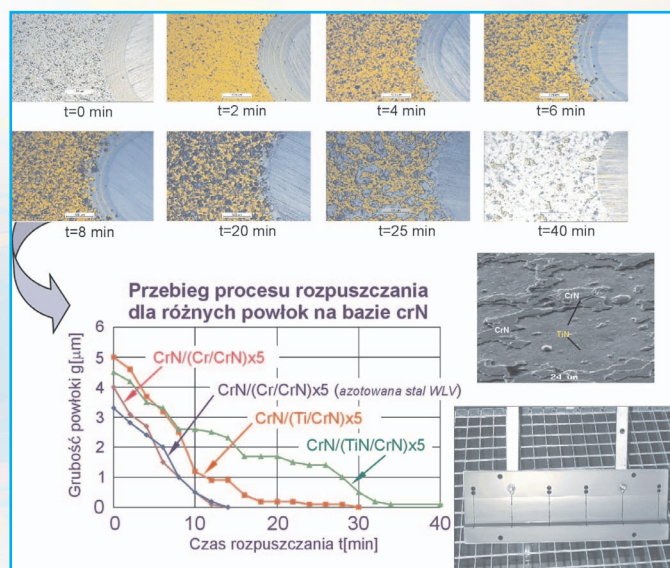
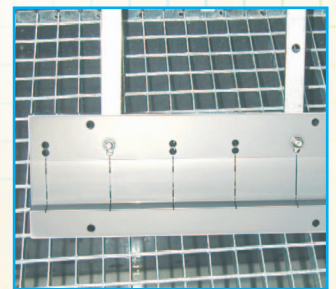
CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE

Technologia jest przeznaczona do usuwania powłok PVD komponowanych na bazie CrN z powierzchni narzędzi i elementów maszyn ze szczególnym uwzględnieniem elementów wielkogabarytowych oraz elementów o złożonych kształtach. Należy ona do grupy technologii wspomagających procesy regeneracji oraz procesy technologiczne obróbki powierzchniowej, w których wykorzystywane są powłoki z udziałem CrN.



WŁAŚCIWOŚCI

Opracowana technologia może być wykorzystana do usuwania powłok na bazie CrN z powierzchni elementów wykonanych ze stali zawierającej powyżej 1 % Cr, w tym: stopowych stali narzędziowych, stali szybkotnących oraz stali nierdzewnych. Specjalnie zaprojektowane i skonstruowane stanowisko technologiczne umożliwia realizację procesów rozpuszczania dla powłok monowarstwowych CrN, jak również dla powłok wielowarstwowych, w skład których oprócz CrN wchodzi warstwy składowe azotków lub węglików innych metali bądź też warstwy składowe czystych metali. Tyristorowy układ sterujący TPR-16 umożliwiający płynną regulację parametrów elektrycznych procesu z dokładnością $\pm 1\%$ oraz dobór składu chemicznego elektrolitu stwarzają możliwość precyzyjnego dostosowania parametrów technologicznych dla różnych, pod względem składu i struktury, powłok na bazie CrN.



odpowiednich parametrów technologicznych zapewnia optymalizację prędkości procesu rozpuszczania materiału powłoki, jak również zachowanie jakości powierzchni elementu stalowego na poziomie sprzed pokrywania powłoką na bazie CrN.